

株式会社ジェイ・イー・ティ

2026年12月期第2四半期（中間期） 決算説明会資料

2026年8月25日

1. 会計不正の概要と原因、再発防止策について
 2. 2026年12月期第2四半期決算概要と通期予想
 3. 事業再構築の方向性（安定的な黒字体制の確立に向けて）
- Appendix

会計不正の概要と原因 再発防止策について

不祥事に関するお詫び

当社は2026年5月1日付で公表した「特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」のとおり、特別調査委員会の調査の結果、過年度において不適切な会計処理が行われていたことに加え、そこに経営トップやマネジメント層の関与が認められました。

株主、投資家の皆さまをはじめ、お取引先、お客様及び関係者の皆さまに、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

当社は調査委員会にて示された原因分析及び提言を真摯に受け止め、2026年6月30日付リリースのとおり再発防止策を策定、また本件に関与した経営トップを含む取締役3名についても、同日のリリースにて公表のとおり辞任、新体制での船出を期しております。

全役職員が一丸となって再発防止策の速やかな実行に努め、社会的な信頼の回復に努めて参ります。

会計不正の概要と調査結果①

- ✓ 当社は半導体製造装置の開発・製造・販売を事業とし、装置の立上に関連する役務提供が完了した時点で収益を認識する「立上報告基準」を売上計上基準として採用
- ✓ しかし当該基準の整備・運用が十分に徹底されておらず、売上計上時期を恣意的に操作することが可能になっていた
- ✓ 特別調査委員会の調査の結果、2022年12月期から2024年12月期にかけて、複数の半導体洗浄装置の売上計上時期を不正に操作する会計不正が行われていたことが判明

注1

注1 15装置に疑義がかけられ、そのうち11装置が該当

会計不正の概要と調査結果②

(単位:百万円) 単位以下切り捨て

	装置売上高(円) 税抜き金額	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期	2024年12月期	2025年12月期
売上高		-	-527	-651	1,178	-
営業利益		-	-160	-175	336	-
経常利益		-	-160	-175	336	-
当期純利益		-	-160	-175	336	-
2023年12月期から2022年12月期への売上計上の前倒し						
装置c	263,500,000	-	-263	263	-	-
装置d	263,500,000	-	-263	263	-	-
2024年12月期から2023年12月期への売上計上の前倒し						
装置e	269,000,000	-	-	-269	269	-
装置f	269,000,000	-	-	-269	269	-
装置g	269,000,000	-	-	-269	269	-
装置h	394,380,000	-	-	-394	394	-
装置i	394,380,000	-	-	-394	394	-
2023年12月期から2024年12月期への売上計上の先送り						
装置j	147,000,000	-	-	147	-147	-
装置l	270,000,000	-	-	270	-270	-
2023年12月期第4四半期から同第3四半期への売上計上の前倒し(年度影響はなし)						
装置m	263,500,000	-	-	-	-	-
装置n	263,500,000	-	-	-	-	-
合計		-	-527	-651	1,178	-

出所:特別調査委員会結果報告書より当社作成

©J.E.T. Co., LTD. All rights reserved

決算修正



(単位:百万円)

	項目	訂正前	訂正後	影響額	増減率
2022年12月期	売上高	23,114	23,420	305	1.3%
	営業利益	2,078	2,200	122	5.9%
	経常利益	1,896	2,018	122	6.4%
	当期純利益	1,197	1,217	19	1.6%
	総資産	28,290	28,551	260	0.9%
	純資産	8,340	8,274	-65	-0.8%
2023年12月期	売上高	24,984	23,129	-1,855	-7.4%
	営業利益	2,613	1,762	-851	-32.6%
	経常利益	2,444	1,593	-851	-34.8%
	当期純利益	1,651	1,128	-522	-31.6%
	総資産	28,774	29,817	1,042	3.6%
	純資産	12,411	11,823	-587	-4.7%
2024年12月期	売上高	17,880	19,316	1,436	8.0%
	営業利益	789	1,087	297	37.6%
	経常利益	662	960	297	44.9%
	当期純利益	318	540	221	69.5%
	総資産	25,491	26,026	534	2.1%
	純資産	12,469	12,103	-366	-2.9%

出所:2026年5月29日過年度決算短信等の訂正リリースより通期数字を記載

会計不正の原因

1. 経営者の資質の問題

経営トップを含む複数のマネジメント層が上場企業の経営者として備えるべき会計リテラシーに欠けていた

2. 製品販売の売上計上基準の整備・運用の問題

売上計上基準である「立上報告基準」について正式な社内規程やマニュアル等が存在せず、社内での継続的な教育や研修も行われず、整備・運用の徹底が不十分であり、当該基準に対する個人の認識差が生まれ恣意的な判断が入り込む余地があった

3. 財務部による牽制機能の問題

売上計上は営業部内で完結する承認フローとなっていたため、財務部など他部門が第2線として牽制する機能がなかった。またCFOがCSOを兼任し、管理部門担当の取締役が事実上、不在となっていた

4. 内部監査室による内部監査の問題

売上計上のプロセスを対象とする内部監査が立上報告書の署名確認などに留まり、売上計上の帰属期間にかかる不正を想定した立上作業の進捗状況の確認などが行われていなかった

5. ガバナンスの問題

当社のガバナンスを担う常勤監査役や社外役員の会計不正に対する感度が鈍かった

再発防止策の概要①

1. 会計リテラシーや誠実性を備えた経営トップによる経営体制の構築

- 本件事案に関与した取締役3名は2026年7月15日開催の株主総会終結を持って辞任
- 本件事案に関与しなかった平井が代表取締役を務めるとともに9月開催予定の臨時株主総会において、会計リテラシーと誠実性を備えた取締役、管理部門専任の取締役を選任、新しい経営体制の構築を図る
- 平井を委員長とし、社外取締役や常勤監査役、アドバイザーである公認会計士などから構成される「改善対策推進委員会」を設置する
- 当社グループの全役職員を対象にコンプライアンス教育を少なくとも年2回実施する

2. 立上報告基準の「立上完了」の定義の見直し

- 「立上完了」の定義について改善対策推進委員会において検討し、アドバイザーである公認会計士からの助言を踏まえ、厳格化・明確化する

再発防止策の概要②

3. 売上計上基準の整備・運用の徹底

- ・ 見直し後の売上計上基準を販売管理規程等の関係規定に明記し、その具体的な運用方法を示した売上計上マニュアルを作成、営業部門だけでなく生産部門など立上業務に関与する部門、最終承認機能を果たす財務部を含む全社に周知する
- ・ 内部統制体制整備プロジェクトとも連携し、最優先課題としてその運用の徹底を図る

4. 売上計上における財務部の承認の制度化

- ・ 財務部が第2線として金額的重要性のある製番の売上計上時期の適切性を確認した上で、売上計上を承認する

5. 管理部門専任の取締役の選任

- ・ 2026年9月開催予定の臨時株主総会において、管理部門専任の取締役を選任し、管理部門全体の牽制機能を強化する

再発防止策の概要③

6. 不正リスクを想定した内部監査の実施

- ・ 売上計上の期間帰属の恣意的な操作が行われる不正リスクを想定した内部監査を実施する
- ・ 監査手続の結果について定期的に三様監査会議に報告し、不正リスクを認識した場合は速やかに情報共有を行い、三様監査の連携を強化し、会議の運営等を改善する
- ・ 内部監査機能の強化のため人員を増員する

7. 会計不正リスク対応のガバナンス強化

- ・ 会計不正対応のガバナンス体制を強化する新たな経営体制を構築する
- ・ 当社の全役員を対象に外部の専門家を招いたコンプライアンス研修を3ヵ月に1回実施する
- ・ 当社グループの全従業員を対象にコンプライアンス教育を少なくとも年2回実施する
- ・ 社外取締役協議会に社外監査役も加えた会議体を設定し、必要な議論を行うことを検討する

2026年12月期第2四半期決算概要 通期予想

業績サマリー

中国の半導体メーカー、韓国のメモリーメーカー向け洗浄装置の立上は完了も、米国で立上中の韓国ファウンドリ向け装置が下期売上になり減収。前期からは改善も部材等の棚卸評価損の計上で営業利益、経常利益はマイナス、特別調査委員会費用等もあり厳しい決算に

売上高 6,183百万円 前期比 $\Delta 13.5\%$	営業利益 $\Delta 574$ 百万円 前年同期比 —	経常利益 $\Delta 636$ 百万円 前年同期比 —	当期純利益 $\Delta 1,063$ 百万円 前年同期比 —
--	--	--	---

- ✓ 半導体業界においては生成AI関連需要の拡大を背景にデータセンター向け先端ロジック半導体及びHBMを中心としたメモリー向け設備投資が高水準で推移
- ✓ 2ナノ世代を始めとする先端プロセス投資や先進パッケージング技術への投資も拡大、半導体製造装置市場は成長軌道に
- ✓ 一方で、成熟世代半導体や一部用途向け投資については選別的な投資姿勢に

連結業績

単位(百万円)	2025年12月期 中間期	売上比(%)	2026年12月期 中間期	売上比(%)	対前期増減	2026年12月期 通期予想
売上高	7,145	—	6,183	—	△962	15,443
売上総利益または 売上総損失	75	1.0%	738	11.9%	663	
販管費	1,350	18.9%	1,312	21.2%	△38	
営業利益または 営業損失	△1,275	—	△574	—	701	△75
経常利益または 経常損失	△1,342	—	△636	—	706	△162
当期純利益または 当期純損失	△2,128	—	△1,063	—	1,065	△1,093

単位未満切り捨て、比率は小数点以下第2位を四捨五入

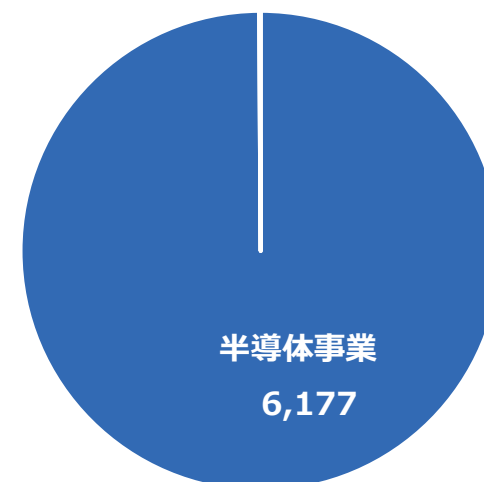
- ✓ 売上は前期比9億62百万円減収、赤字幅は減収もあり縮小
- ✓ 中国の半導体メーカー、韓国のメモリーメーカー向けの洗浄装置の立上は完了。
米国で立上中の韓国ファウンドリメーカー向け装置は下期に売上が遅延
- ✓ 前年からは改善も部材等の棚卸評価損の影響で営業利益、経常利益はマイナス。
純利益は特別調査委員会の費用等の計上もあり更に減益に

売上高・経常利益推移 売上構成

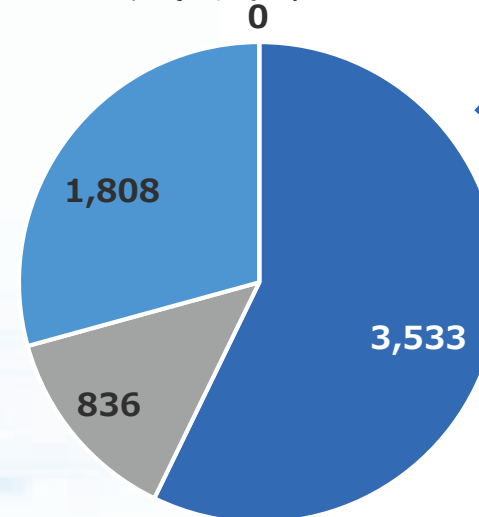
売上高・経常利益推移



セグメント別連結売上高



半導体事業内訳

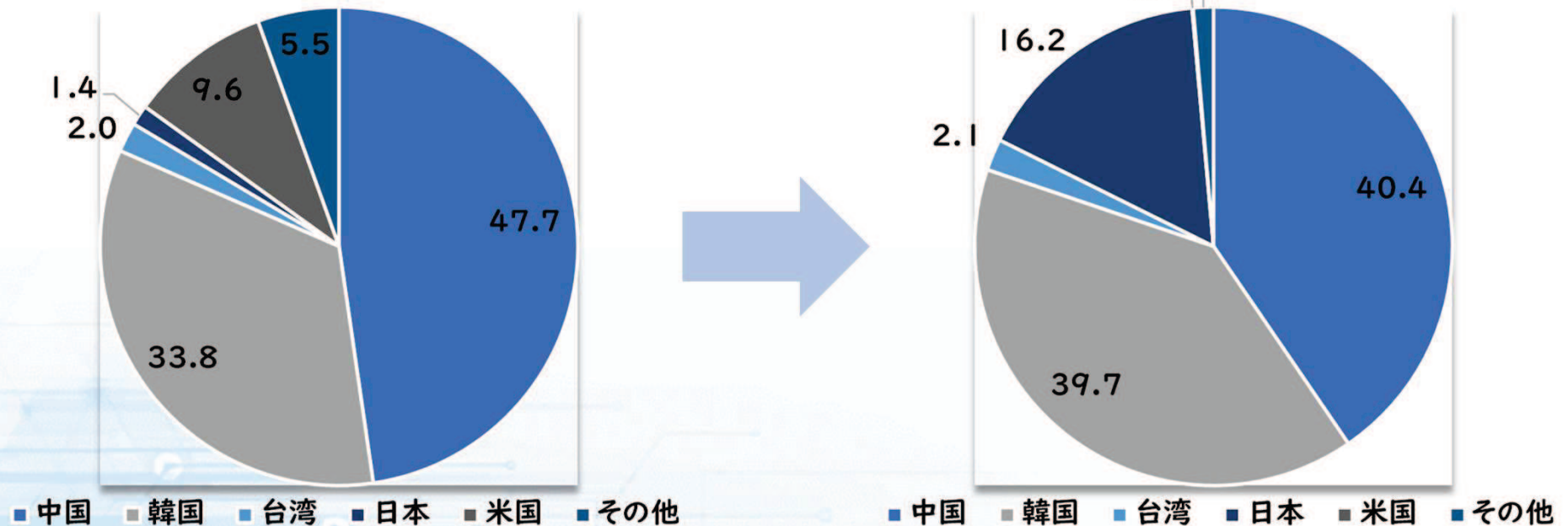


2026年12月期
上期実績

■ バッチ式 ■ 枚葉式 ■ 工事・部品他 ■ その他

半導体事業 地域別売上高構成比推移①

2026年12月期上期 中国での苦戦を受け構成比も47.7%から40.4%に減少

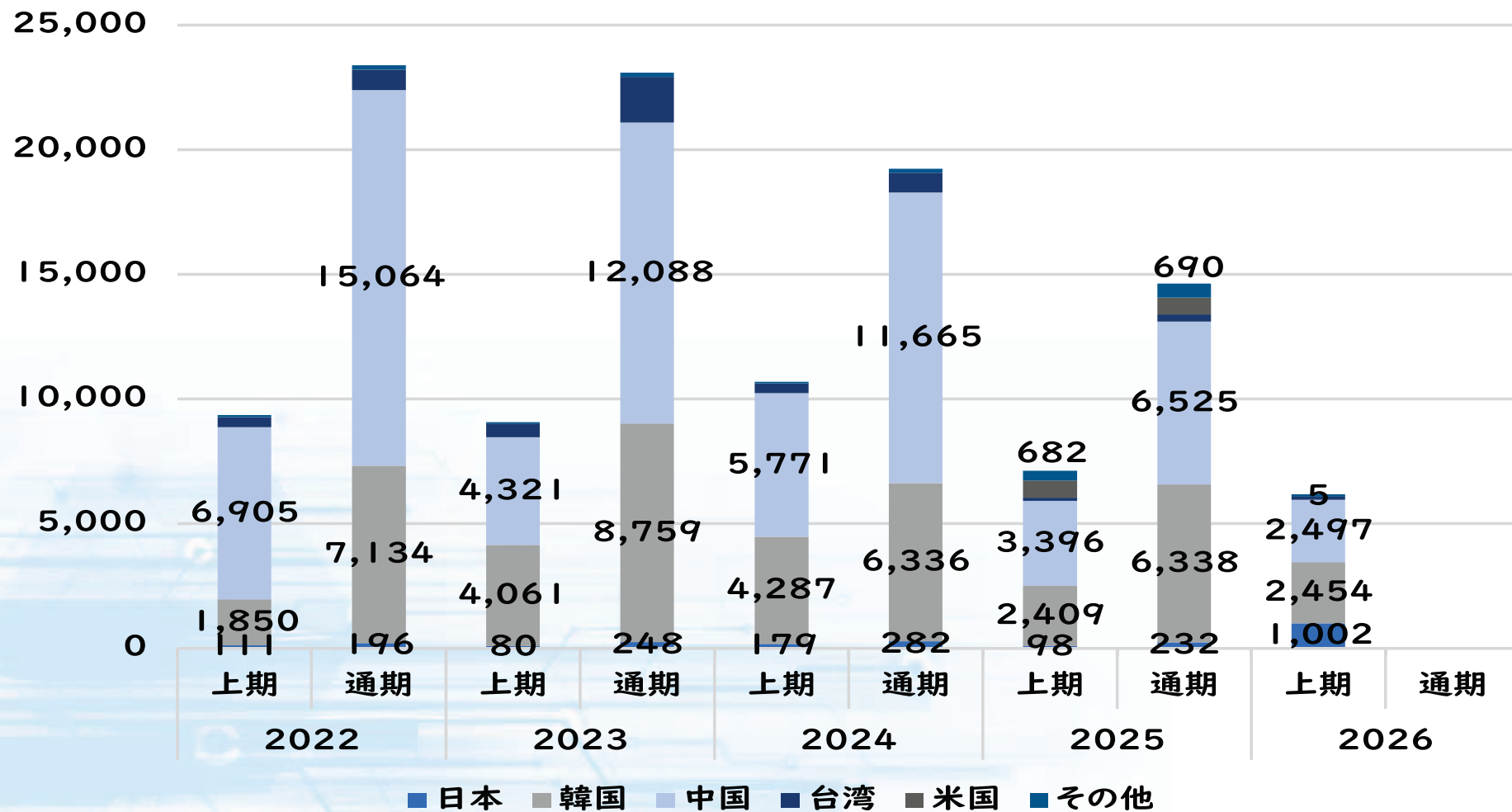


2025年12月期上期 単位%

2026年12月期上期 単位%

地域別売上高構成比推移②

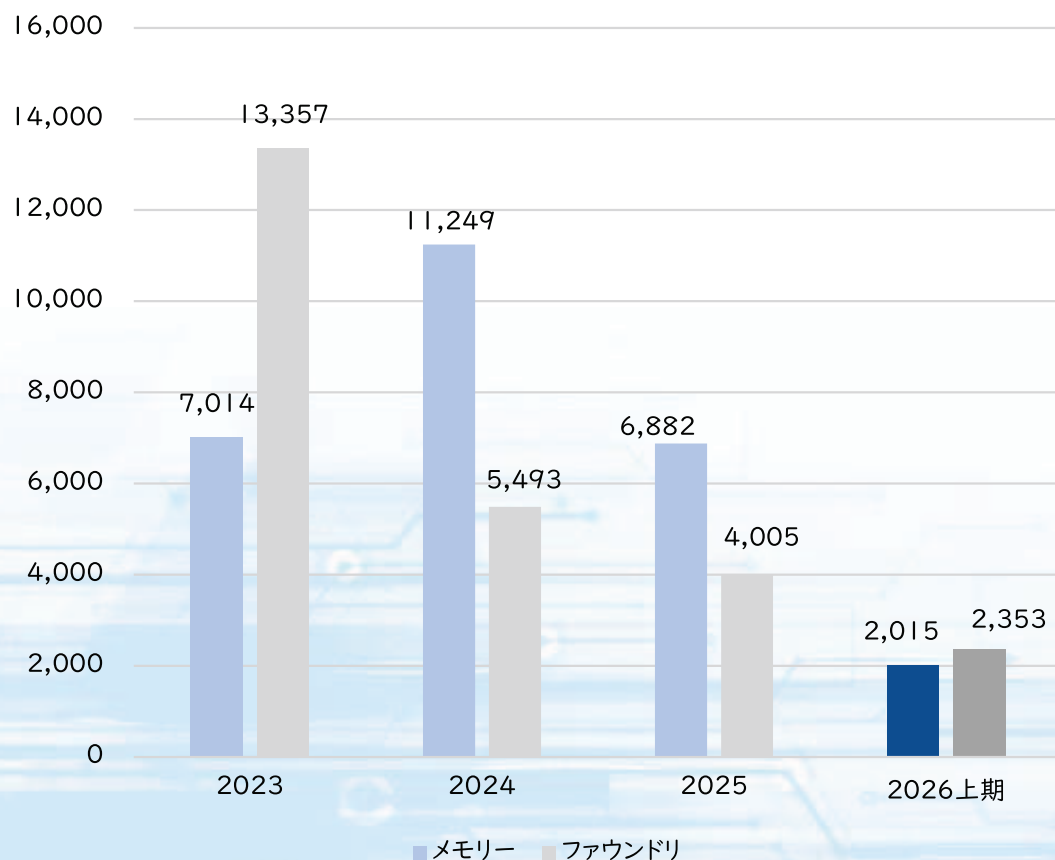
Rapidusへの納入で日本で10億円を超える売上を記録



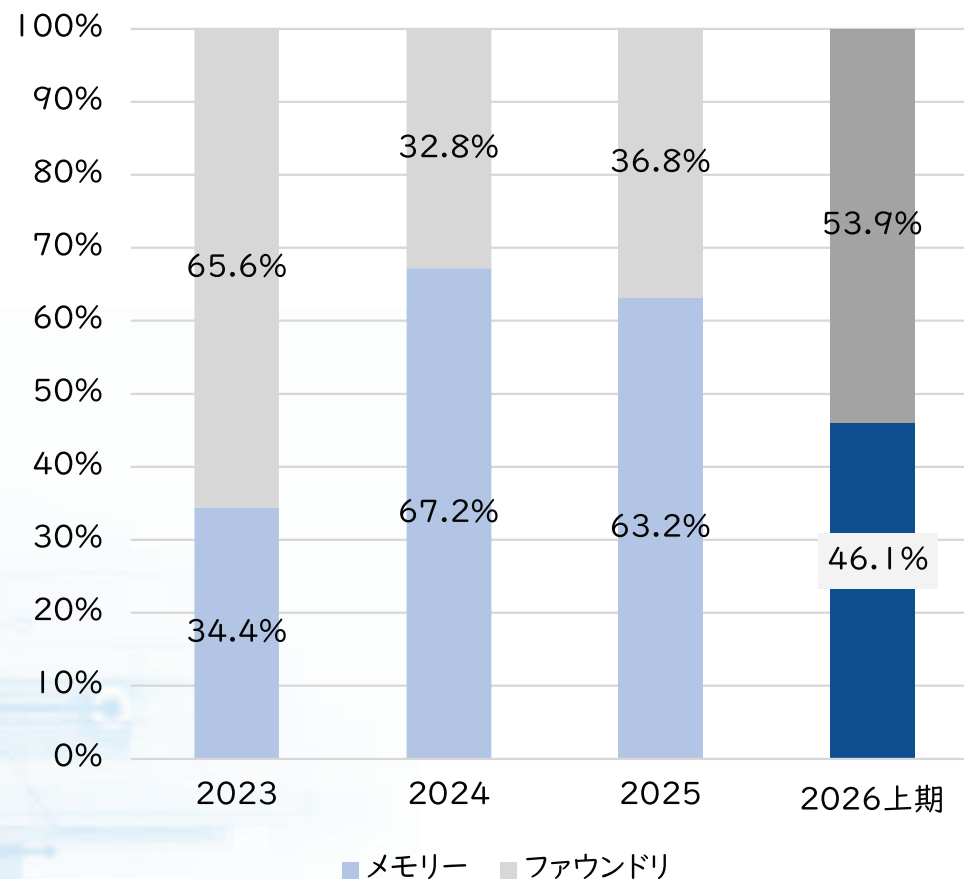
装置売上高推移（仕向け先別）

売上は減少、構成比としてはファウンドリの比率が高い

装置売上高仕向け先別推移



装置売上高仕向け先別構成比推移



連結貸借対照表

単位(百万円)	2025年12月期	2026年12月期 中間期	増減	主な増減要因
流動資産	18,103	17,249	△854	「原材料及び貯蔵品」の減少
有形固定資産	1,151	1,938	786	
無形固定資産	102	124	22	
投資その他資産	155	139	△15	
資産合計	19,512	19,452	△60	
流動負債	5,573	6,697	1,123	「短期借入金」の増加
固定負債	4,218	4,019	△199	「長期借入金」の減少
負債合計	9,792	10,717	924	
純資産合計	9,720	8,735	△985	「利益剰余金」の減少
負債純資産合計	19,512	19,452	△60	

単位未満切り捨て

米国ハイパースケーラーの天文学的なデータセンター投資で市場環境は好転

- ✓ メモリーは米国ハイパースケーラーの天文学的なデータセンター投資を背景に、AI主導で昨年後半からDRAM及びNANDフラッシュの価格は上昇
- ✓ 韓国メモリーメーカーもDRAMの微細化や積層数増加によるHBMの容量拡大、NANDフラッシュの3D構造の更なる高層化に向けた投資を拡大
- ✓ 2026年6月29日には「大韓民国大飛躍プロジェクト」としてサムスン、SKハイニックス今後5年で国内に4工場を建設との計画を発表。投資総額は800兆ウォン（約83兆円）
- ✓ 中国においても先端化に向けたファウンドリ、メモリーメーカーの投資堅調
- ✓ 2026年は日本製半導体装置の販売高は過去最高を更新する見通し

2026年12月期通期業績予想

予想数値としては黒字に至らないが、全社挙げて経常利益の通期黒字化を目指す

売上高
15,443百万円

前期比 5.3%

営業利益
△75百万円

前期比 ー

経常利益
△162百万円

前期比 ー

当期純利益
△1,093百万円

前期比 ー

- ✓ 投資を積極化する韓国メーカーに対し働きかけを強める
- ✓ 国産化対応施策を通じ中国市場での巻き返し、既存顧客との関係強化を図る
- ✓ 米国、韓国ファウンドリメーカー向け装置は2026年12月期中の立上完了を予定
- ✓ 選別受注の徹底、装置設計の見直し、装置仕様の最適化、装置製作の内製化などコスト削減への取り組みを強める

＊ 「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」交付については交付決定を辞退
2026年8月10日リリースご参照

事業再構築の方向性

事業再構築による安定的な黒字化の実現

選別受注による原価率の改善、R&Dによる高付加価値製品の開発、統制強化により安定して利益を創出する体制に転換する

短期戦略

早期黒字化の
実現

利益構造改革

- ・ 不採算案件の排除による原価率改善

統制強化

- ・ 承認フローによる統制強化

中長期戦略

利益を創出する
体制の確立

収益力強化

- ・ 高付加価値製品 (Eco3/BW3500) へ集中
 - ・ 三星、SK Hynixに対する深耕化
- ### 生産効率向上
- ・ コア社員育成を通じた付加価値向上
 - ・ 工程見直しによるリソースの有効活用

【韓国】深耕化

- 三星：NAND向けリン酸装置のシェア奪還
- SKハイニックス：枚葉式装置の再アプローチを実施

【北米】新規開拓

- TIへリソースを集中

【中国】既存顧客の関係強化

- DRAM：CXMT強化
- NAND：YMTC強化

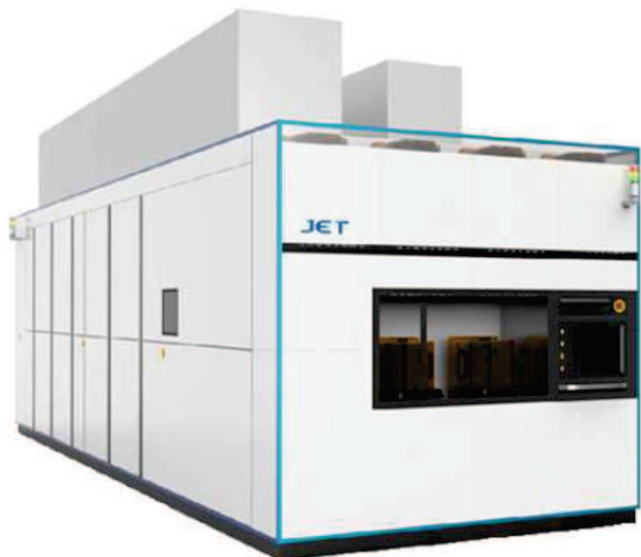
【日本】既存顧客の関係強化

- ラピダス：Eco3にリソースを集中

【台湾】新規開拓

- UMCへHTSフリーデモ実施、実績を作り拡販に繋げる

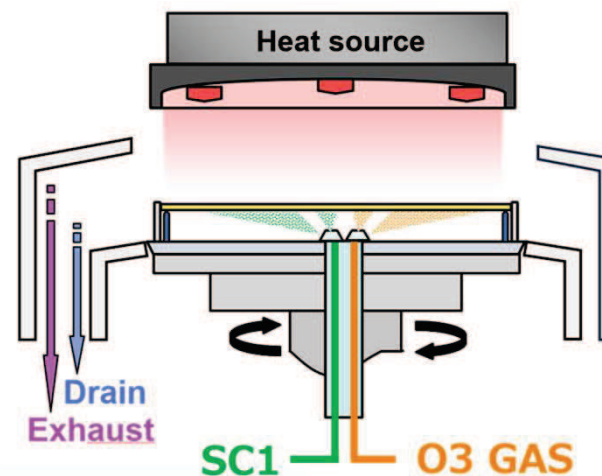
バッチ式BW3500、枚葉式Eco3、高付加価値機種への集中を強める



BW3500

28mm以上のプロセスをターゲットにしたBW3000の後継機種

- ・フットプリントの削減、操作性向上など顧客ニーズに応えた機種
- ・新たな搬送方式を採用
- ・環境、安全対策にも配慮したほか、破損防止のため樹脂槽を採用
- ・RCA洗浄の他社製品からの切り替えを意識

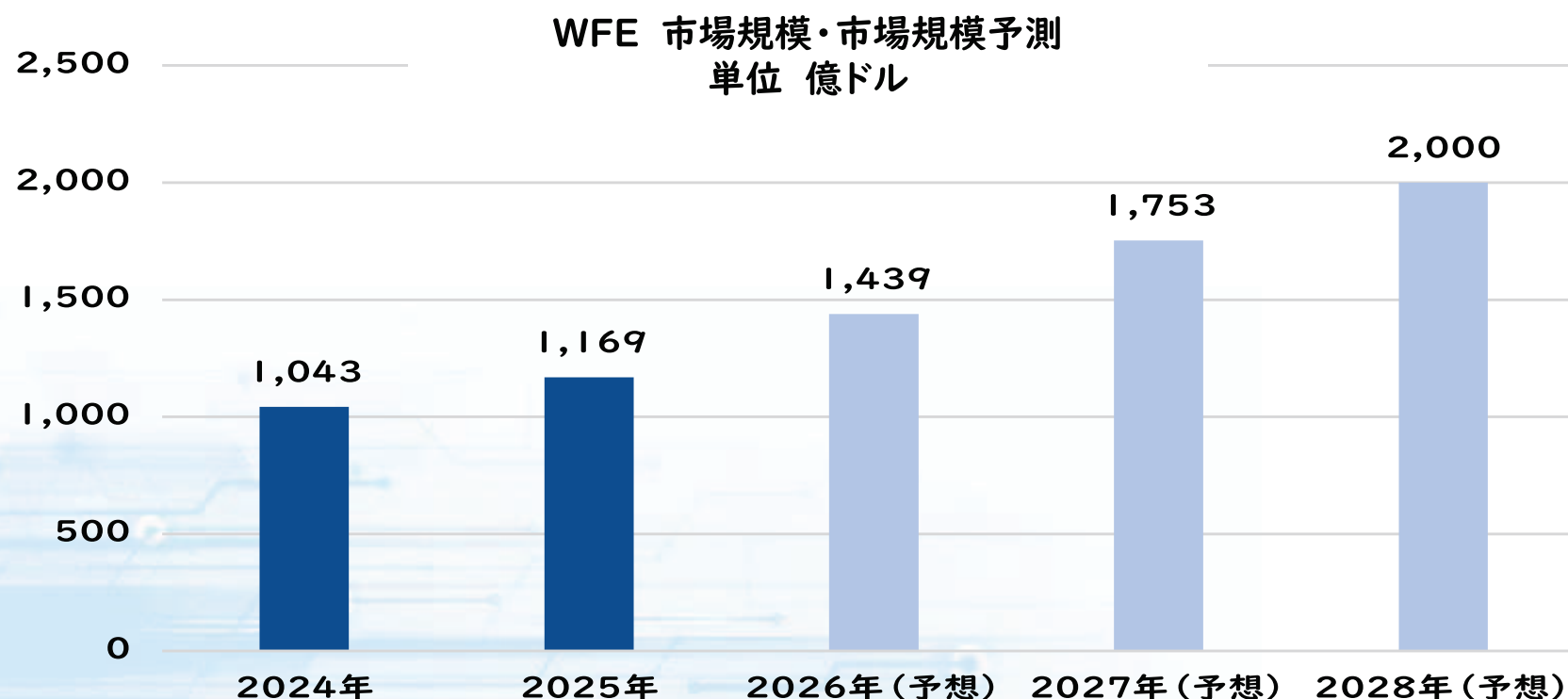


Eco3

環境への負荷が少なく、ランニングコストも低い

- ・枚様式SPM装置の構造を生かし、O3 GASでの処理を実現
- ・O3 GASを使用することで環境負荷を軽減しながらSPM同様のプロセスが可能
- ・酸とアルカリによる反応生成物が形成されないため、1つの処理モジュールでSC1処理可能

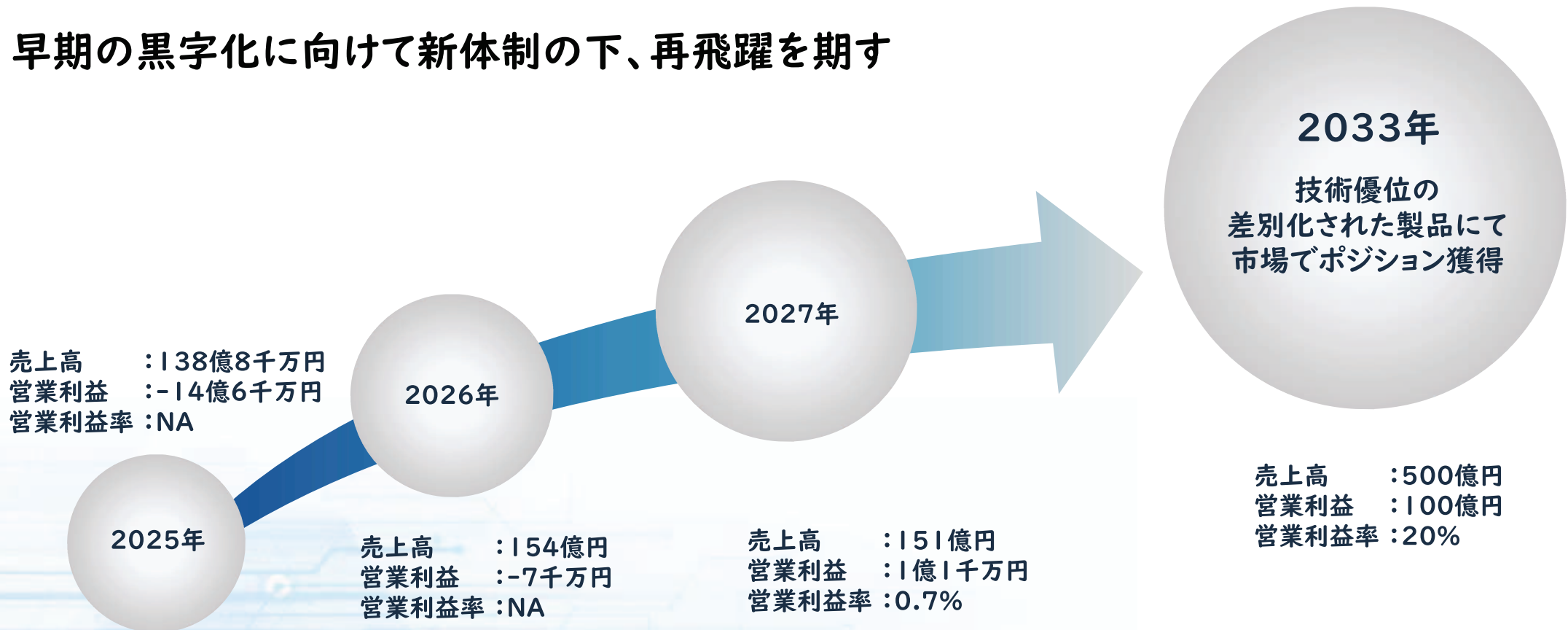
AIインフラ、先端ロジック、先進メモリ、HBM投資などを背景に
半導体前工程向け製造装置の販売額は2028年には2,000億ドル突破の予想



出所: SEMI2026年7月14日リリースより弊社作成

数値目標

早期の黒字化に向けて新体制の下、再飛躍を期す



2033年の数値目標達成を目指し、
臨時株主総会後、新体制において9月より中期経営計画の再検討を予定

Appendix

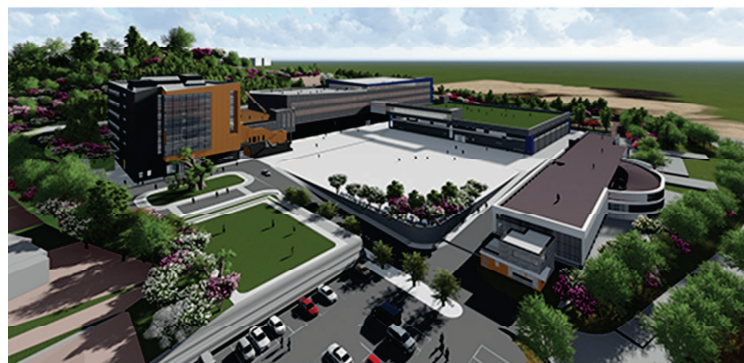
リーマン・ショック後の半導体不況時に民事再生手続を開始し、その後破産手続に移行したエス・イー・エス(株)が前身同社の卓越した半導体洗浄装置に関する技術を継承すべく、販売代理店であった韓国企業のZEUS CO., LTD. (以下、「ZEUS」)の全額出資のもと、2009.4.24に設立、2009.5にエス・イー・エス(株)の岡山工場等を事業譲渡により引き継ぎ誕生

■ 会 社 概 要

会 社 名	株式会社ジェイ・イー・ティ
英 訳 名	J.E.T. Co., LTD.
設 立	2009年4月
資 本 金	1,848百万円(2025年12月31日時点)
所 在 地	岡山県浅口郡里庄町新庄金山6078番
T E L	0865-69-4080
代 表 者	代表取締役専務 平井洋行
従 業 員 数	176名 266名 ※連結会社含む全従業員数 (2026年6月30日現在)
事 業 内 容	半導体洗浄装置の開発・製造・販売・アフターサービス等
主 要 納 入 先	サムスン電子(韓国) SMIC(中国)

グループ関係図

親会社ZEUSとは事業の棲み分けがなされ、競合関係もなく、経営についても役職員の出向等の受け入れを廃止し独立性の確保を図る



所在地: 大韓民国
京畿道華城市

資本金: 15,530,995千KRW

事業の内容: 半導体・液晶用各種製造装置の製造・販売

当社の議決権の保有割合(%) : 66.3% (直接)

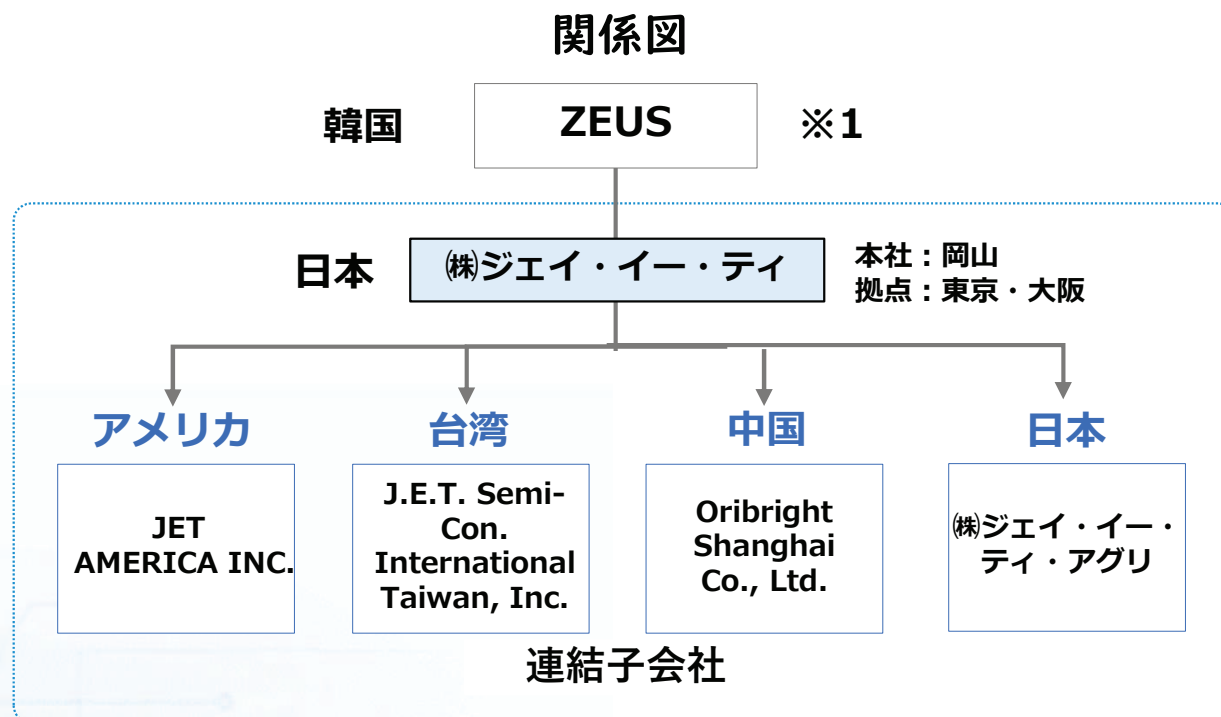
関連当事者

との関係: 営業取引

取引の内容: 双方より部品・材料等の販売・仕入及び装置製造業務委託、当社よりZEUSへ販売手数料支払い等

*2022年4月末までは、当社にてZEUSより非常勤取締役1名を受け入れていたが、2022年5月以降、ZEUSから当社への役職員の出向等による受け入れは行っていない。

*JET韓国については、2026年1月1日付で韓国支社として活動を継続。



拠点

JET

■ 国内拠点
■ 海外拠点



韓国支社
21名

J.E.T. Korea Co., Ltd.

Oribright Shanghai Co., Ltd. 北京事務所

Oribright Shanghai Co., Ltd. 無錫事務所

Oribright Shanghai Co., Ltd. 合肥事務所

Oribright Shanghai Co., Ltd. 西安事務所

Oribright Shanghai Co., Ltd. 広州事務所

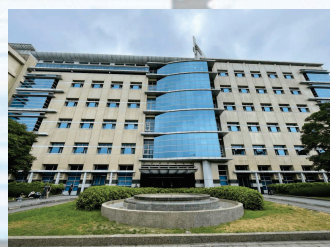
Oribright Shanghai Co., Ltd. 上海本社



中国拠点 63名

* 中国拠点については、一部の事務所の掲載を省略しております。

J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.
(HEAD Office) 台湾本社



J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.
(Singapore branch) シンガポール支社

シンガポール 4名

九州出張所(※1)

大阪事務所(※2)

東京事務所(※1)

(株)ジェイ・イー・ティ

- 本社
- 笠岡ファーム(※1)

本社 (岡山)



- ※1 東京事務所及び九州出張所では、当社顧客へのフィールドサービスを提供。
- ※2 大阪事務所は、LIB製品の営業を担当。
- ※3 笠岡ファームでは、当社連結子会社(株)ジェイ・イー・ティ・アグリがトマトを栽培。



JET AMERICA INC.

米国拠点
3名

本資料の取扱上の注意

- 本資料は、2026年8月14日発表の決算短信に基づいて作成されています。
- また、本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき 判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証したり、約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度などの変化により、大きく見通しが変動する可能性があります。
- 本資料に記載しております数字につきましては、単位未満切り捨てで処理しております。また、比率は四捨五入しております。

本資料に関するお問い合わせ先

株式会社ジェイ・イー・ティ
経営戦略部
TEL 0865-69-4281